Japanese Patent Office Patent Laying-Open Gazette

Patent Laying-Open No.

5-317030

Date of Laying-Open:

December 3, 1993

International Class(es):

C12M 1/00

1/32

1/36

F25B 21/02

H01L 35/28

(5 pages in all)

Title of the Invention:

Biochemical Reaction Device with

Microchamber

Patent Appln. No.

4-128543

Filing Date:

May 21, 1992

Inventor(s):

Tsuyoshi Fujita

Shinnichiro Umemura

Noritaka Uchida

Applicant(s):

Hitachi, Ltd.

Partial English Translation of Japanese Patent Laying-Open No. 5-317030

... Omitted ...

[Title of the Invention]

Biochemical Reaction Device with Microchamber
... Omitted ...

[0019] In the mixing and agitation, a slighter trace of cocktail results in a more enhanced diffusion effect. Diffusion rate is proportional to volume and it is thus believed that the cocktail of $0.5\,\mu$ l is randomly mixed 200 times faster than that of 200 μ l. Microoscillation of high frequency can be applied to the entirety of the chamber to promote the diffusion effect. If the promoted diffusion effect is insufficient, three-dimensional microfabrication can be employed to construct a oscillator or rotor in the chamber. One possible configuration employed is that of a device which employs controlled electrostatic force for flexing a thin silicon plate to oscillate a thin silicon film. A large number of aligned electrostatic motors can also be fabricated on a silicon wafer.

... Omitted ...

[0023] In Fig. 1, the base material for the device is silicon. Anisotropic etching is employed to form a hole of an appropriate volume serving as a chamber, and a semiconductor Peltier device configured of elements 101-105 is then formed on the bottom surface of the hole. Elements 101 and 102 are p and n semiconductors formed by diffusion (i.e. semiconductor process), respectively. Element 103 is a lead wire. Element 104 is a heater and cooler plate (a temperature controller plate). Element 105 is a fixed-temperature contact common to the all wells. The temperature of temperature controller plate 104 can be controlled independently for each well by appropriately controlling the temperature of fixed-temperature contact 105 and applying an appropriate

voltage to lead wire 103 at the both ends. The Peltier device can also be used as a temperature-measuring thermocouple by measuring the potential difference between the ends of the lead wire without applying a voltage to the lead wire. Furthermore, temperature controller portion 104 and a thermocouple portion 201 can be separately formed in processing the well, as shown in Fig. 2. The well according to the present embodiment has a mouth of 1.2mm in length and 1.2mm in width, and a bottom surface of 0.6mm in length and 0.6mm in width due to the characteristics of the crystal face of silicon, and has a depth of 0.42mm. The well has a maximum volume of $0.35\,\mu$ l.

[0024] As temperature controller plate 104, a copper electrode of the Peltier device is used intact. However, if the copper electrode is considered to have significant influence on the cocktail, the electrode is covered with a ceramic aluminum plate, a polymer with good thermal conductivity or the like to avert the influence.

[0025] The well is surrounded by oxidized SiO₂ which provides an larger effect of heat insulation than the base material, i.e. silicon.

[0026] Fig. 3 is a bird's-eye view of an automatic, sample preparing apparatus incorporating therein the chamber plate shown in Fig. 1. A reaction device 100 employing the microchamber plate is fixed on a platform 301 which is configured of a socket of an electrode of the chamber plate and a temperature controller for controlling the temperature of the fixed-temperature contact. High frequency oscillation can also be applied to the chamber plate to enhance the diffusion effect in the well.

... Omitted ...

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-317030

(43)公開日 平成5年(1993)12月3日

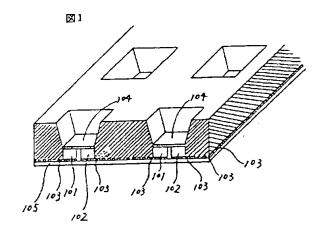
(51)IntCl. ⁵ C 1 2 M 1/00 1/32	競別記号 A	庁內整理番号	FI	技術表示箇所
1/36 F 2 5 B 21/02 H 0 1 L 35/28	B Z	8919-3L 9276-4M	審査請求 未請求 請求項の	数7(全 5·頁)
(21)出願番号	特顯平4-128543		(71)出願人 000005108 株式会社日立製作所	
(22)出願日	平成4年(1992)5月	月21日	東京都千代田区神田駿河台 (72)発明者 蘇田 毅 埼玉県比企郡鳩山町赤沼公 社日立製作所基礎研究所内	520番地 株式会
			(72)発明者 梅村 晋一郎 埼玉県比企郡鳩山町赤沼2 社日立製作所基礎研究所内	
			(72)発明者 内田 憲孝 埼玉県比企郡鳩山町赤沼2 社日立製作所基礎研究所列	
			(74)代理人 弁理士 小川 勝男	

(54)【発明の名称】 マイクロチャンパを用いた生化学反応装置

(57)【要約】

【目的】極微量のサンプルを様々な反応条件で同時に処理することが可能となる新規な生物学的および生化学的分析に供する装置、例えばDNAや蛋白質に代表される生体高分子反応を行なうマイクロマルチチャンバ装置およびその利用方法、製造方法の提案

【構成】開口部面積1.2mm×1.2mm以下、もしくは深さ1.4mm以下のチャンパを多数配列し、各々のチャンパ内に独立に制御することの可能な温度調節機能を有する生化学反応装置。シリコンウェハに半導体プロセスにより多数の孔と、その内部に半導体ペルティエ素子(101~105)を形成する。チャンパ毎に印加電圧を制御することにより、独立に温度調節可能としたものである。



【特許請求の範囲】

【請求項1】二次元平面上に配列された多数の孔(チャ ンバ)を持つ生化学反応容器において、各々のチャンバ に独立した温度調節が可能な温度調節機能を組み込んだ ことを特徴とする生化学反応装置。

1

【請求項2】前記生化学反応容器は12行×8列穴のマ イクロタイタープレートであることを特徴とする請求項 1 記載の生化学反応装置。

【請求項3】前記各チャンバの大きさが、開口部におい 徴とする請求項1記載の生化学反応装置。

【請求項4】前記各チャンバの大きさが、深さにおいて 1.4mm以下の大きさであることを特徴とする請求項 1 記載の生化学反応装置。

【請求項5】母材をSiウエハとし、反応容器となるチ ャンバを前記Siウエハの一表面にエッチングにより成 形し、チャンパ周囲を酸化することにより、チャンパを 熱伝導率の低いSiО₂で囲まれた構造にすることを特 徴とする請求項1記載の生化学反応装置。

【請求項6】母材をSiウエハとし、反応容器となるチ 20 ャンバを前記Siウエハの一表面にエッチングにより成 形し、その各チャンバ内に独立したペルティエ素子を配 置し、各素子は独立して制御されることを特徴とする請 求項1記載の生化学反応装置。

【請求項7】二次元平面上に配列された多数のチャンパ を持つ生化学反応容器の、各々のチャンパに独立した温 度調節が可能な温度調節機能を組み込んだ生化学反応装 置を用いて核酸増幅反応を行うに際し、各チャンバごと に温度及び/または温度を保持する時間を独立に変化さ せることを特徴とする核酸増幅反応方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は生物学的および生化学的 分析に供する装置、例えばDNAや蛋白質に代表される 生体高分子反応を行なうマイクロマルチチャンバ装置お よびその利用方法、製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】多数の生化学的試料を同時に扱うマイク ロマルチチャンパとしては、いわゆる12行×8列のマ イクロタイタープレートを含むマイクロウエルテストプ 40 レートがあり、これに規格を同じくしたハンドリング装 置やインキュベータ、遠心装置等の周辺装置も実用化さ れている。マイクロウエルテストプレートに反応装置と して分離膜や機能膜を有するように設計されたマイクロ フィルトレーショントレーとしては、特開 平2-18 7110に見られるように、免疫学的検査やマイクロク ロマトグラフなどを目的とした使い捨ての装置を提供す るものがある。

【0003】しかし、現在実用化されているマイクロタ イタープレートは単に試料を保持する容器でしかなく、

またマイクロフィルトレーショントレーについても、ウ ェル毎に独立に反応条件を制御することは非常に困難で あり、特に温度調節を独立に行うことは不可能であると 考えられる。

2

【0004】さらにまた、現在市販されているマイクロ タイタープレートは、容量が10μ1~1mlのオーダ ーの大きさのチャンパであり、極微料の試料を取り扱う ことや高速で温度調節を行うには適していない。

【0005】一方、極微量の試料を扱うマイクロチャン て1. 2 mm×1. 2 mm以下の大きさであることを特 10 バとしては、特公平2-34597号の "細胞を選別す るための装置および方法"や、特開平-131569号 の "マイクロチャンバプレートおよび粒子判別法ならび に粒子処理装置および細胞処理装置"がある。これらは 細胞一個の大きさを扱うマイクロチャンバを提供し、か つ半導体プロセスによって組み込んだ電極等によって、 独立に各チャンパに電圧を印加すること等についての方 法および装置を提供しているが、どちらも主に細胞を取 り扱うことを目的とするもので、DNAや蛋白質に代表 される生体高分子反応を行うには最適とは言えないと考 えられる。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】生化学反応の主なもの は、分離、精製、撹拌混合、インキュベート(反応温度 保持)であり、これらを10°~10′個のオーダーで同 時に処理できれば、現在の生化学的な仕事のスループッ トは飛躍的に向上すると考えられる。例えば、現在癌化 と関係する様々な遺伝子およびその変異部位が同定され つつあり、その数は数百種類にも及んでいるが、これら の部位を同時に検査、検出できれば、診断の精度やスル 30 ープットは大きく向上する。また遺伝子解析において、 10000クローンを超える遺伝子ライブラリのスクリ ーニングなどを行なう上では、一枚のプレート上に少な くとも1000個以上のチャンパが並んでいることが望 ましい。一方、医療診断や腫瘍細胞などの部位特異的発 現機構を調べる上では、準備可能な検体試料の量の点か ら考えると、多数であると同時に微量の試料を取り扱う 必要がある。

【0007】また近年発明されたイン ヴィトロ(In Vitro) での核酸増幅反応(PCR法)は、反応 液の温度制御によって様々な新しい診断手法や実験手法 を可能とし、その結果、生化学の研究作業の中でイン ヴィトロで行うことのできる範囲がかなり拡大してきて いる。この場合に重要となってくるのは、反応液全体の 均一かつ高速度な温度制御技術である。

【0008】従って本発明の目的は、まず微量の反応試 料を十分な濃度で反応させ得る装置を提供するものであ る。また、反応液の温度制御をより迅速にかつ均一に行 えるようにした装置を提供することにある。

【0009】さらに本発明の他の目的は、チャンパ自体 を能動的な反応装置とすることにより、同時に多数の生 化学的試料を取り扱うことを可能とし、また必要に応じ て個々の試料について独立に反応条件を設定することを 可能とする装置を提供すること、加えてこの装置により 可能となる新たなプロトコールの一例を提供するもので ある。

【0010】また、生化学の反応装置は、時として致命 的な影響を与える混合汚染(コンタミネーション)を防 ぐために使い捨て可能(ディスポーザブルタイプ) であ ることが好ましい。そこで、大量生産を可能とし、ディ スポーザブルタイプの反応装置を提供することも本発明 10 の目的である。

[0011]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた め、それぞれのチャンバを容量0.5μ1以下に微小化 し、微少量の反応液を効率良く取り扱えるようにした。 【0012】また、各チャンバ毎にペルティエ素子によ り形成されるヒータおよび冷却器を設け、そのヒータお よび冷却器に直接反応液を接触させることにより反応液 の温度制御を行なえるようにした。

【0013】加えて、チャンバの加工に半導体プロセス 20 を利用することにより、大量生産を可能とした。

[0014]

【作用】チャンバを微小化し微少量の反応液を扱えるよ うにすることにより、微量の反応試料を十分な濃度で反 応させることが可能となる。例えば、0.5μ1の反応 液の中で反応を行わせると、100μ亅の反応液の場合 と同温度の反応を行うためには1/200の量の試料が あれば良く、逆に言えば、同じ量の試料で濃度は200 倍となる。このことは反応出発試料の微量化だけでな く、酵素等の使用量も少なくすることとなり、低コスト 30 化にもつながると考えられる。

【0015】また、反応液の微量化に加えて各チャンバ ごとにヒータおよび冷却器を取付け、そのヒータおよび 冷却器に直接反応液を接触させることにより、反応チャ ンパごとに反応液を独立に温度制御し、かつ、その温度 制御を迅速に行うことが可能となる。チャンパ母材をシ リコンとして、異方性エッチングによってチャンバとな る適当な体積の孔を掘った後、表面のある面に対して、 PNPN…からなる半導体ペルティエ素子を形成し、各 により、独立に温度制御(加熱も冷却も同一の素子によ り) が可能となる。また、すべてのチャンバ内加工が終 了した後に、チャンバ周囲を酸化することにより、チャ ンバを熱伝導率の低いSiO2で囲まれた構造にするこ とも可能である。

【0016】このようにして作ったチャンバにおいて は、ペルティエ素子の吸熱および発熱量の限界は、吸熱 時 0 . 15W/m m²、発熱時 0 . 18W/m m²程度と 見積もられる。この条件において、酵素反応の開始およ び終了を精度良く制御するための温度変化の速度を $\Delta \, 2 - 50$ 同時に加工することが容易であるので、装置自体をディ

5℃/sec以上とすると、深さは最大でも1.4mm 以下である必要がある。

【0017】一方、チャンバ加工を施す面積は、装置の 小型化や手に入り易いシリコンウェハの大きさ、加工や ハンドリングの容易さから判断して、80mm×80m m以下の大きさの四角形状配列が良いと考えられる。先 述のように、今後の遺伝子診断や遺伝子解析に用いる上 では、一枚のウェハ上に少なくとも1000個のチャン バが並んでいることが望ましい。この場合80mm×8 0 mmの正方形状にチャンバの一辺と同じピッチで10 00個のチャンパを配列するためには、チャンパの一辺 は1.2mm以下であることが必要となる。

【0018】ところで、シリコンウェハを異方性エッチ ングにより加工する場合、開口部形状を正方形とする と、穴形状は正方形錐状となり、その底面と側面のなす 角度は約50°である。この形状において、深さをヒト 卵細胞 (直径約200μm) が扱える420μmとし、 開口部を1.2mm×1.2mmの正方形とするとペル ティエ素子を形成する底面は0.6mm×0.6mmの 正方形状となる。このようにして作ったチャンバにおい ては、ペルティエ素子の吸熱および発熱量は、吸熱時 0.05W、発熱時0.06W程度と見積もられるが、 上記のような開口部1.2mm×1.2mm、深さ0. 4 2 m m の場合、体積は最大 0. 3 5 μ 1 となり Δ 2 5 ℃/secを満足する。ただし従来の温度調節器は、反 応液をいれた反応チューブを恒温槽に装着することによ って液温を調節していたので、チューブの熱抵抗やチュ ープとヒータ間の熱接触なども問題となっていたが、本 発明のように加熱もしくは冷却器が直接反応液に接して いれば、効果的な温度調節が可能である。

【0019】混合撹拌の点においても、反応液が微量で あれば拡散の効果が大きくなる。拡散の速度は、およそ 体積と比例関係にあるので、0.5μ1の反応液中では 200μ1の場合に比べて200倍の速さでランダムな 混合が進むと考えられる。チャンバ全体に対して高周波 の微少振動を加えることによって、拡散効果を助長する こともできる。これだけでは十分といえない場合は、チ ャンバ内に三次元微細加工によって振動子もしくは回転 子を構築する方法をとれば良い。たとえば、薄くしたシ ペルティエに独立に配線を行い付加電圧を制御すること 40 リコン板を静電気力によってたわませて、その静電気力 をコントロールすることによって、シリコン薄膜を振動 させる装置も実現されているが、この構造を利用するこ とが考えられる。また、シリコンウェハ上に多数の静電 モータを並べて作ることも可能である。

> 【0020】これらの加熱および冷却素子や撹拌要素 を、半導体プロセスによって各チャンパごとに構築する ことによって、多数の反応装置が平面上に配列されたマ イクロチャンバ装置を提供することが可能である。しか も半導体プロセスによれば、多数のマイクロチャンパを

スポーザブルにすることも可能となる。

【0021】このような装置を用いることによって、反 応温度と反応時間をパラメータとした新しい実験手法が 可能となる。例えば、PCR法を行なう場合には、変性 温度、再会合温度、伸長温度の3種類の温度とその保持 時間が、反応の効率(場合によっては生成産物の有無) を決定する。反応液の微量化により精度よく設定温度を 制御し、かつ、反応液ごとに独立な温度制御の行い得る 本装置を用いれば、同じ反応液に対して異なる設定温度 で同時に反応を行ない、最適な実験条件における産物を 10 迅速に得ることが可能である。またそれだけでなく、D NA配列中の点変異などが、敏感に最適再会合温度に影 響することを利用して、遺伝子診断などをより正確に効 率よく行なうことも可能となる。加えて本装置では、D NAポリメラーゼによる伸長時間を分解能良く制御する ことにより、反応生成物の特異性を向上させることも可 能である。

[0022]

【実施例】以下、本発明の一実施例を図1~図4により 説明する。図1、2は本発明のマイクロチャンバを用い 20 た生化学反応装置、図3は上記装置を要素として組み込 んだ自動試料調製装置である。また図1〜図4において 共通部分の番号は同一とした。

【0023】図1において、装置の母材はシリコンであ り、異方性エッチングによってチャンバとなる適当な体 積の孔を掘った後、底面に101~105からなる半導 体ペルティエ素子が形成されている。101、102は 拡散法 (半導体プロセス) により形成したP型およびN 型半導体、103はリード線、104はヒータおよび冷 却プレート (温調プレート)、105は全ウェル共通の 30 ェル中の微量反応液の蒸発を防ぐことが可能である。 定温度接点である。定温度接点105を適当な温度に制 御しておき、リード線103の両端に必要な電圧をかけ ることにより、104に示す温調プレートの温度をウェ ル毎に独立に制御可能である。また、リード線に電圧を かけず両端の電位差を測定すればこのベルティエ素子を 温度計測用の熱電対として使用することも可能である。 場合によっては、図2に示すようにウェル加工時に温調 部分104と熱電対部分201を別々に形成することも 可能である。本実施例においてウェルの大きさは、開口 部は縦1.2mm×横1.2mmで深さ0.42mm、 シリコン結晶面の特性から、底面は縦0.6mm×横 0. 6 mmとなり、ウェルの容積は最大 0. 3 5 μ 1 と なる。

【0024】温調プレート104としてはペルティエ素 子の銅電極をそのまま用いているが、銅電極の反応液に 対する影響が重要な場合には、この電極の上をセラミッ クアルミプレートや熱伝導性の良いポリマ等で覆うこと により対策する。

【0025】またウェルの周囲は酸化されたSiOzと なっており、熟絶縁の効果が母材のシリコンに比べて大 50 実現し、遺伝子解析や遺伝子診断の分野の発展に寄与で

きくなるようになっている。

【0026】図3は図1に示したチャンパプレートを組 み込んだ自動試料調製装置の鳥瞰図である。マイクロチ ャンパプレートを用いた反応装置100は台301に固 定される。台301は、チャンパプレートの電極のソケ ットおよび定温度接点の温度制御のための温度調節器よ り構成されている。ウェル内の拡散の効果を高めるため に高周波の振動をチャンパプレートに与えられるような 構造にすることもできる。

【0027】302はピペッタ303とマイクロチャン バプレートのふた304を搬送するXYステージであ る。ピペッタ303はサブマイクロリットルの分注が可 能なマイクロキャビラリを用いたピペットを有し、極微 量の試薬およびサンプルを精度よく分注することが可能 である。このピペッタが、溶液保存容器305と反応装 置100との間を往復しながらウェル内に反応液を供給 する。超極微量の試薬の供給には、キャピラリなどのピ ペットではなく単なる針先を用いる方法もある。すなわ ち、中空部分を持たず試薬に浸した針先の表面を濡らし ている試薬を、針先を反応液に接触させることによっ て、反応液中に拡散させるのである。試薬の濃度および 濡れ面積をコントロールすることにより超極微量の試料 供給が可能となる。

【0028】ふた304はマイクロチャンパと同様な位 置配列に浅い溝の加工をして、上面にペルティエ素子を 形成したものである。このふた304は、分注時以外 は、ウェルにたいして溝が一致するように押しつけられ (図4)、それぞれのウェルの反応液よりもわずかに (2~3℃)高い温度に制御される。このことによりウ

【0029】この自動試料調製装置は、分離機能膜等の 分離要素、さらに多種類の試薬供給要素などと組み合わ せることにより、非常に小型大量処理の生化学反応装置 を構成し得ると考えられる。また今後の三次元微細加工 技術の進歩により、ウェル中に撹拌要素や分離要素を含 むチャンバプレートも実現可能であると考えられる。

【0030】本明細書においては、主に1μ1以下の容 量を持つマイクロチャンパプレートについて述べてきた が、本発明の重要項目である、独立した制御の可能な温 40 度調節機能や撹拌、分離機能を各々のチャンパが有する 反応装置に関しては、チャンパの大きさが制限を受ける ものではなく、いわゆる12行×8列のマイクロタイタ ープレートに上記のような反応要素を組み込んだ反応装 置も、本発明の含む範囲である。

[0031]

【発明の効果】本発明によれば、極微量のサンプルを様 々な反応条件で同時に処理することが可能となる。この ことにより、従来扱えなかった極微量のサンプルを出発 試料とする、生化学反応の最適化、高スループット化を 7

きる。

【0032】また周辺装置との組合せにより、生化学反応自動装置の小型化を実現する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例のマイクロチャンパプレート を用いた生化学反応装置

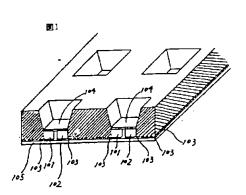
【図2】本発明の他の実施例のマイクロチャンバブレー トを用いた生化学反応装置

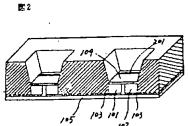
【図3】図1で示した生化学反応装置を組み込んだ自動 試料調製装置の一例を示す鳥瞰図 【図4】図3で示した自動試料調製装置において、マイクロチャンパプレートにふた部プレートを装着した状態の図

【符号の説明】

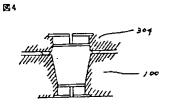
100…マイクロチャンパプレートを用いた生化学反応 装置、101,102…P型およびN型半導体、103 …リード線、104…温度調節プレート、105…定温 度接点、201…熱電対部分、301…マイクロチャン パプレートの台、302…XYステージ、303…ピペ ッタ、304…マイクロチャンパプレートのふた

【図1】





[図2]



【図4】

[図3]

